

ネットワークポリマー

Vol. 38 No. 4 (2017)

目次

巻頭言

基礎は役に立つ

…………長谷川 喜一………… (157)

報文

有機強塩基を発生するアセト酢酸塩型光塩基発生剤の合成および

チオール-エポキシ混合樹脂のアニオン UV 硬化への応用

…………有光 晃二・柳 正義・古谷 昌大………… (158)

アリールメチルピリジニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボラート塩類の合成と

カチオン型の熱潜在性エポキシ樹脂硬化剤として応用

…………松本 幸三・玉川 純也・遠藤 剛………… (166)

ビスフェノール A とホルムアルデヒドを用いたノボラック樹脂の合成と性質：

ビスフェノール類に着眼した柔軟性をもつフォトレジスト材の開発

…………山崎 博人・西村 利康・山崎 椋太・江口 まり音………… (173)

高分子量クレゾールノボラック樹脂の合成と物性

…………増田 克之・坂井 絵厘・波江野 滋・平田 知広………… (184)

解説

新規イソシアヌル酸骨格エポキシ樹脂の開発動向

…………田中 章博………… (192)

若手研究者の目

「動き」のある高分子材料

…………玉手 亮多………… (199)

告知板

…………… (200)

Journal of Network Polymer, Japan

Vol. 38 No. 4 (2017)

Contents

Original

- Synthesis of Acetoacetate – Derived Photobase Generators for Generation of Organic Superbases and Their Application for Anionic UV Curing of Thiol-Epoxy Mixed Resins
.....Koji ARIMITSU, Masayoshi YANAGI, and Masahiro FURUTANI..... (158)
- Synthesis of Arylmethylpyridinium Tetrakis(pentafluorophenyl)borates and Their Application to Cationic Thermally-Latent Curing Agents for Epoxy Resins
.....KOZO MATSUMOTO, Junya TAMAGAWA, and Takeshi ENDO..... (166)
- Synthesis and Properties of Bisphenol A-Formaldehyde Novolac Resins:
Development of Photo-resist Material Having Flexibility Noticed with Bisphenol unit
.....Hirohito YAMASAKI, Toshiyasu NISHIMURA, Ryota YAMASAKI,
and Marine EGUCHI..... (173)
- Synthesis and Properties of High Molecular Weight Cresol-novolac-resin
.....Katsuyuki MASUDA, Eri SAKAI, Shigel HAENO, and Tomohiro HIRATA..... (184)

Discription

- Development Trend of New Epoxy Resin Containing Isocyanuric Structure
.....Akihiro TANAKA..... (192)

Japan Thermosetting Plastics Industry Association

Maruishi Building

1 – 10 – 4, Kajichou, Chiyoda-ku,

Tokyo, 101 – 0044 Japan

TEL. (03) 5298 – 8003

FAX. (03) 5298 – 8004
